

京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点利用内規

(平成23年 3月 23日拠点マネージャー裁定制定)

(趣旨)

第1条 この内規は、京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点（以下「ハブ拠点」という。）の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 ハブ拠点の利用は、科学技術の発展に資する研究開発に係る実験研究を目的とするものに限るものとする。

(利用日)

第3条 ハブ拠点の利用日は、次の各号に掲げる日以外の日とする。

- (1) 日曜日及び土曜日
- (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号において「祝日法による休日」という。)
- (3) 12月29日から翌年1月3日まで(祝日法による休日を除く。)
- (4) 6月18日(創立記念日)
- (5) 8月第3週の月曜日、火曜日及び水曜日(夏季一斉休業日)

2 前項の規定にかかわらず、運営責任者(京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点要項(平成30年7月31日ナノテクノロジーハブ拠点ユニット長裁定制定)第3第1項の規定によるものをいう。以下同じ。)が特に必要と認めたときは、臨時に利用させ、又は利用を中止させることがある。

(利用時間)

第4条 ハブ拠点の利用時間は、午前9時から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、運営責任者が特に必要と認めたときは、利用時間を延長し、又は短縮することがある。

(利用者の資格)

第5条 ハブ拠点を利用することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。

- (1) 本学の教職員及び学生
- (2) 学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
- (3) 企業等に所属し、研究開発に従事する者
- (4) その他運営責任者が特に必要と認めた者

(利用形態)

第6条 利用者によるハブ拠点の利用形態は、以下のとおりとする。

- (1) 別表第1に定める装置群(以下「装置群」という。)又は別表第2に定める実験室等(以下「実験室等」という。)(以下「装置群等」という。)の利用
- (2) 技術代行及び技術補助並びに事前講習(以下「技術代行等」という。)の利用

(利用の申請)

第7条 装置群等を利用しようとする者は、所定の方法により運営責任者に申請し、その許可を受けなければならない。

2 装置群等の利用期間は、許可を受けた日から最長で6か月とし、利用期間終了後も継続して

利用したい場合には、再度申請を行うものとする。

- 3 技術代行等を利用しようとする者は、文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業に則って研究成果の公開についてあらかじめハブ拠点と合意したうえで、所定の方法により運営責任者に申請し、その許可を受けなければならない。
- 4 前3項によりハブ拠点を利用しようとする者は、利用に当たってハブ拠点の職員に相談することができる。
- 5 運営責任者は、第1項又は第3項の規定により利用を許可した者に対して、その旨を通知するものとする。
- 6 運営責任者は、第1項又は第3項の利用の許可に際し必要と認めるときは、当該利用について必要な条件を付すものとする。
- 7 第1項又は第3項の利用の許可を受けた者は、当該利用に関し責任者（以下「利用責任者」という。）となる。
- 8 利用責任者は、利用の許可を受けた後において、利用日時を変更する場合は、速やかに運営責任者に申し出て、その許可を受けなければならない。
- 9 利用責任者は、利用の許可を受けた後において、自己の都合により利用を中止する場合、速やかに運営責任者に届け出なければならない。

（利用責任者の責務）

第8条 利用責任者は、ハブ拠点の利用に関し、次の各号に掲げる事項を遵守し、適正に利用しなければならない。

- (1) 利用を許可された装置群について、高度専門技術職員等による十分な教育を受けること。
- (2) 利用を許可された装置群等及びその設備、備品等の保全に努めること。
- (3) 利用を許可された目的以外に使用しないこと。
- (4) 利用を許可された装置群等及びその設備、備品等の一部又は全部を他の者に転貸しないこと。
- (5) 利用を許可された装置群等及びその設備、備品等に対し、運営責任者の許可なく改造、変更等を行わないこと。
- (6) その他運営責任者が定め、又は指示する事項

（利用の許可の取消等）

第9条 運営責任者は、次の各号の一に該当する場合、ハブ拠点の利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

- (1) 利用責任者が、この内規に違反し、又は違反するおそれがあると運営責任者が認めるとき。
- (2) 利用責任者が、所定の申請書に虚偽の記載をしたとき。
- (3) 本学において、管理上の事由が生じたとき。

（報告義務）

第10条 利用責任者は、運営責任者からその利用に係る事項について報告を求められた場合は、それに応じなければならない。

（利用負担金等）

第11条 利用責任者は、本学の指定する方法により、利用負担金等を納付しなければならない。

- 2 利用負担金等の額は別途定めるところによる。
- 3 一旦納付された利用負担金等は、返還しない。ただし、次の各号に掲げる場合は、利用負担

金等の全部又は一部を返還する。

(1) 本学の都合により利用の許可を取り消し、又は利用を中止させた場合

(2) 利用責任者の都合により装置群等の利用を中止したときに、納付された利用負担金等を第6項に規定するキャンセル料に充当してもなお残額がある場合

4 利用負担金等は、月毎に利用実績に応じて請求する。

5 利用負担金等は、本学の発行する請求書により、請求書発行日の翌月末までに納付しなければならない。

6 装置群等の利用について、装置利用日の22営業日前の日以降に、第7条第9項の届出があった場合、利用責任者は、別に定めるキャンセル料を納付しなければならない。ただし、当該利用に係る利用負担金等が、すでに納付されている場合は、その利用負担金等をキャンセル料に充当する。

(消耗品等)

第12条 装置群等で使用する消耗品、材料等は、原則利用責任者が準備し、その費用を負担するものとする。

2 利用責任者は、ハブ拠点にある消耗品、材料等を使用した場合、その実費を負担するものとする。

3 利用責任者が準備し、その費用を負担する消耗品、材料等については、本学の諸規程に従い運営責任者が使用を認めたもののみハブ拠点において使用することができるものとする。

(損害賠償)

第13条 利用責任者は、本人又は当該利用に係る関係者がその責に帰すべき事由により装置群等若しくはその設備又は物品を滅失し、破損し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(原状回復)

第14条 利用責任者は、装置群等の利用を終えた場合（第9条又は第17条第3項の規定により運営責任者が利用の許可を取り消し、又は利用を中止させた場合を含む。）は、直ちに当該装置群等を原状に回復して返還しなければならない。ただし、運営責任者が特に認めたときは、この限りではない。

2 利用責任者が原状回復の義務を履行しないときは、運営責任者は利用責任者の負担においてこれを行うことができる。この場合において、利用責任者は、運営責任者に異議を申し立てることができない。

(装置群等利用の明記)

第15条 利用責任者は、装置群等を利用して行った研究の成果を論文等により公表するときは、当該論文等に、ハブ拠点及び当該装置群等を利用した旨を明記するものとする。

(免責)

第16条 ハブ拠点は、利用者がその目的を達成するように協力し、及び支援するが、目的の達成を保証するものではない。

2 ハブ拠点は、ハブ拠点の装置群等の利用によって利用者に生じた損害について、責任を負わないものとする。

3 ハブ拠点は、ハブ拠点の装置群等の利用に基づいて利用者が行った商品の販売、役務の提供その他の行為によって利用者に生じた損害について、責任を負わないものとする。

(安全衛生管理)

第17条 利用責任者及びハブ拠点の装置群等の利用に係る関係者は、当該ハブ拠点における安全衛生管理について、関係する法令及び本学の諸規程（以下「法令等」という。）を遵守するとともに、法令等に基づき運営責任者が行う指示に従わなければならない。

2 利用責任者は、騒音、振動、水質汚濁、悪臭等の環境問題が発生しないよう、予防措置を講ずるものとし、問題が発生した場合は、利用責任者の責任において速やかに解決のための措置を講じなければならない。

3 前項の問題が解決されない場合は、運営責任者は、装置群等の利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることがある。

(秘密保持)

第18条 ハブ拠点の教職員は、業務上知りえた、利用者の機密である旨が文書で明示された技術上の情報（機密である旨を明示して口頭で開示された技術上の情報であって、開示後速やかに文書により機密である旨が明示されたものを含む。以下「秘密情報」という。）について、第三者に対し開示し、又は漏洩してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、法令等により開示が義務付けられているとき、又は主務官庁、裁判所その他の公的機関より法令等に基づき開示の請求等を受けたときは、秘密情報の開示を必要かつ相当な範囲で行うことができる。

3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報には適用されないものとする。

- (1) 利用者から開示を受けた際、既にハブ拠点が所有していた情報
- (2) 利用者から開示を受けた際、既に公知又は公用であった情報
- (3) 利用者から開示を受けた後、ハブ拠点の責によらずに公知又は公用となった情報
- (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず適法に入手した情報
- (5) 利用者が事前に文書により開示を承諾した情報

4 利用者相互における秘密保持に関しては、利用者自身の管理に委ねるものとし、ハブ拠点は一切の責務を負わないものとする。

5 前各項に定めるもののほか、秘密情報の取扱いに関し必要な事項は、ハブ拠点及び利用責任者で別途協議して決定するものとする。

(知的財産権)

第19条 利用者がハブ拠点を利用した結果生じた知的財産権の取扱い等については、当該発明等の発生事態を勘案して、ハブ拠点及び当該利用者で別途協議して決定するものとする。

(契約等の遵守)

第20条 利用者は、ハブ拠点の利用に関し、京都大学と締結する契約又は約款及び京都大学の定める事項を遵守するものとする。

2 利用者は、ハブ拠点の利用において、特定不正行為（捏造、改ざん、盗用等）その他の不正行為を行ってはならない。

(その他)

第21条 この内規に定めるもののほか、ハブ拠点の利用に関し必要な事項は、運営責任者が定める。

附 則

この内規は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成23年10月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成24年12月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成24年12月16日から施行する。

附 則

この内規は、平成25年10月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成29年6月15日から施行する。

附 則

この内規は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

この内規は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1 装置群

装 置 群			
微細加工装置群	A	吉田キャンパス ／桂キャンパス	ナノリソグラフィー装置群
	B	吉田キャンパス ／桂キャンパス	ナノ材料加工・創製装置群
	C	吉田キャンパス	ナノ材料分析・評価装置群
微細構造解析装置群	D	宇治キャンパス	ナノ微細構造解析装置群

別表第2 実験室等

区分	実 験 室 等	
a	吉田キャンパス ／桂キャンパス	クリーンルーム (イエロールーム、クリーンルーム1、クリーンルーム2、桂クリーンルーム)
b	吉田キャンパス	加工・評価室 (加工・評価室、加工・評価室BF)
c	吉田キャンパス	サテライトラボ (専有部分)
d	吉田キャンパス	サテライトラボ (共有部分)
e	吉田キャンパス	セミナー室

京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点の
利用に係る負担金に関する内規

(平成23年3月23日拠点マネージャー裁定制定)

(趣旨)

第1条 この内規は、京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点利用内規（平成23年3月23日拠点マネージャー裁定。以下「利用内規」という。）第11条第2項の規定に基づき、装置等の利用負担金、実験室等（サテライトラボ（専有部分）及びセミナー室を除く。以下同じ。）の基本料金及び技術代行等における技術料（以下「利用負担金等」という。）並びにサテライトラボ（専有部分）及びセミナー室の利用料金の額等に関し必要な事項を定める。

(利用に係る負担金の額)

第2条 装置等を利用する者は、当該装置等の利用負担金及び当該装置等の利用に係る実験室等の基本料金の合計額を負担するものとする。

2 技術代行及び技術補助並びに事前講習（以下「技術代行等」という。）を利用する者は、当該技術代行等において使用する装置等の利用負担金及び技術料の合計額を負担するものとする。

3 サテライトラボ（専有部分）又はセミナー室を利用する者は、その利用料金を負担するものとする。

(利用負担金の額)

第3条 装置等の利用負担金の額は、別表第1に定める額とする。

(利用負担金の割増し)

第4条 前条の規定にかかわらず、利用内規別表第1の微細構造解析装置群（別表第1のD）の装置等を成果非公開で利用する場合は、別表第1に定める額にその2割5分の額を加えた額を装置等の利用負担金とする。

(利用負担金の上限)

第5条 利用を許可されたテーマごとに利用者が負担する装置等（利用内規別表第1の微細構造解析装置群（別表第1のD）の装置等を除く。以下この条において同じ。）の利用負担金の累積額が、別表第2左欄に定める利用者の種別に応じて同表右欄に定める額（以下「負担上限額」という。）を超えた場合、当該利用を許可された期間中は、当該利用者に対し、当該超えた額の負担は求めないものとする。

2 利用者は、利用を許可されたテーマごとに負担上限額をあらかじめ納付しておくことにより、当該利用を許可された期間中は、装置等の利用負担金を都度納付することなく、当該テーマにおいて装置等を利用することができる。この場合において、当該テーマの使用実績に応じた利用負担金の累積額が負担上限額を下回っても、一旦納付された負担上限額との差額は返還しない。

(基本料金の額)

第6条 装置等利用に係る実験室等の基本料金の額は、別表第3に定める額とする。

(技術代行等における技術料の額)

第7条 技術代行等における技術料の額は、別表第4に定める額とする。

(サテライトラボ及びセミナー室の利用料金の額)

第8条 サテライトラボ(専有部分)又はセミナー室を利用する場合の利用料金の額は、別表第5に定める額とする。

(利用負担金等の割引)

第9条 利用内規第5条第1項第1号及び第2号に掲げる者(以下「1号利用者」という。)

については、利用負担金等の額を、別表第1、第3及び第4に定める額の半額とする。ただし、技術料の額を別表第4に定める額の半額とするのは、事前講習及び微細構造解析装置群利用者の技術補助の技術料の場合に限る。

2 利用内規別表第1の微細加工装置群(別表第1のAからC)の装置等を利用する場合においては、利用内規第5条第1項第3号に掲げる者のうち、文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業に則って研究成果を公開することについてあらかじめハブ拠点と合意した者(以下「成果公開利用者」という。)であって、その所属する機関が中小企業基本法第2条における中小企業者であるもの(以下「2号利用者」という。)については、利用負担金等の額を、別表第1、第3及び第4に定める額の半額とする。ただし、技術料の額を別表第4に定める額の半額とするのは、事前講習の技術料の場合に限る。

3 利用内規別表第1の微細加工装置群(別表第1のAからC)の装置等を利用する場合においては、利用内規第5条第1項第3号に掲げる者のうち、成果公開利用者であって、その所属する機関が中小企業基本法第2条における中小企業者ではない企業であるもの(以下「3号利用者」という。)については、利用負担金等の額を、別表第1、第3及び第4(事前講習の技術料に限る。)に定める額の8割に相当する額とする。

4 利用内規第5条第1項第3号に掲げる者のうち、成果公開利用者であって、学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施するもの(以下「4号利用者」という。)については、利用負担金等の額を、別表第1、第3及び第4に定める額の半額とする。ただし、技術料の額を別表第4に定める額の半額とするのは、事前講習の技術料の場合に限る。

5 利用内規別表第1の微細加工装置群(別表第1のAからC)の装置等を利用する場合においては、利用内規第5条第1項第3号に掲げる者のうち、学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者であって、成果公開利用者でないもの(以下「5号利用者」という。)については、利用負担金等の額を、別表第1、第3及び第4に定める額の8割に相当する額とする。ただし、技術料の額を別表第4に定める額の8割に相当する額とするのは、事前講習の技術料の場合に限る。

6 微細加工装置群を利用するために、ハブ拠点で準備した標準試料を用いて事前講習を

受講する場合の利用負担金の額は、別表第1に定める額（前各項に掲げる者については、前各項の規定により別表第1に定める額から割り引いた後の額）の半額とする。

（キャンセル料の額）

第10条 装置等の利用中止に係るキャンセル料の額は、別表第6に定める額とする。

（新規利用者等の利用負担金）

第11条 第3条、第5条及び第9条の規定にかかわらず、新規利用者及び紹介者の装置等（別表第1に定める微細加工装置群（別表第1のAからC）の装置等に限る。）の利用負担金に関し必要な事項は、別に定める。

（その他）

第12条 この内規に定めるもののほか、利用負担金等及びキャンセル料に関し必要な事項は、京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点要項（平成30年7月31日ナノテクノロジーハブ拠点ユニット長制定）第3第1項に規定する運営責任者が定める。

附 則

この内規は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成23年10月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成24年12月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成24年12月16日から施行する。

附 則

この内規は、平成25年10月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成26年8月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

1 この内規は、令和元年10月1日から施行する。

2 第5条第1項に係る別表第2の規定については、この規程の施行の日の前に利用を許

可された期間が終了する場合は、なお従前の例による。また、利用を許可された期間が施行日前後にまたがる場合は、別表第2に定める金額の110分の100に相当する額を基準とし、施行日前の利用については、利用負担金の合計金額の108分の100に相当する金額を、施行日以後の利用については、利用負担金の合計金額の110分の100に相当する金額をそれぞれ算出し、その累積額が、基準を超えた場合、当該利用を許可された期間中は、当該利用者に対し、それ以降の負担は求めないこととする。

別表1(1). 装置等の利用負担金表

令和元年10月1日 改定

		装置等		利用料金(一時間当り)			設置場所
装置群	No.	機器名	メーカー名	タイプA	タイプB	タイプC	
A ナノリソグラフィ装置	A1	高速高精度電子ビーム描画装置	(株)エリオニクス	26,620円	42,590円	53,240円	イロールーム
	A2	露光装置 (ステッパー)	(株)ニコン	10,650円	17,040円	21,300円	イロールーム
	A3	レーザー直接描画装置	(株)日本レーザー(Heidelberg Instruments社)	7,230円	11,560円	14,450円	イロールーム
	A4	高速マスク露光装置	(株)ナノシステムソリューションズ	4,110円	6,570円	8,210円	イロールーム
	A5	両面マスクアライナー	ズース・マイクロテック(株)	2,870円	4,590円	5,740円	イロールーム
	A6	紫外線露光装置	ミカサ(株)	450円	710円	890円	イロールーム
	A7	厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置	ズース・マイクロテック(株)	1,570円	2,500円	3,130円	イロールーム
	A8	レジスト塗布装置	(株)カナメックス	800円	1,280円	1,600円	イロールーム
	A9	スプレーコータ	ウシオ電機(株)	1,020円	1,620円	2,030円	イロールーム
	A10	レジスト現像装置	(株)カナメックス	800円	1,280円	1,600円	イロールーム
	A11	ウエハスピン洗浄装置	(株)カナメックス	1,490円	2,380円	2,970円	イロールーム
	A12	ICP質量分析装置	アジレント・テクノロジー(株)	2,470円	3,950円	4,940円	イロールーム
	A13	超微細インクジェット描画装置	(株)SIJテクノロジー	1,090円	1,740円	2,170円	イロールーム
	A14	有機現像液型レジスト現像装置	(株)カナメックス	1,070円	1,700円	2,130円	イロールーム
	A15	大面積超高速電子線描画装置	(株)アドバンテスト	35,140円	56,220円	70,280円	加工・評価室1
	A16	近接効果補正システム	GenISys(株)	930円	1,480円	1,850円	-
A53	移動マスク紫外線露光装置	(株)大日本科研	4,350円	6,950円	8,690円	桂クリーンルーム	
A54	両面マスクアライナー露光装置	ユニオン光学(株)	680円	1,090円	1,360円	桂クリーンルーム	
B ナノ材料加工・創製装置	B1	多元スパッタ装置 (仕様A)	キャノンアルパ(株)	4,070円	6,510円	8,140円	加工・評価室1
	B2	多元スパッタ装置 (仕様B)	キャノンアルパ(株)	3,880円	6,200円	7,750円	加工・評価室1
	B3	電子線蒸着装置	キャノンアルパ(株)	3,200円	5,110円	6,390円	クリーンルーム
	B4	真空蒸着装置	(株)サンバック	630円	1,010円	1,260円	加工・評価室1
	B5	プラズマCVD装置	住友精密工業(株)	6,470円	10,340円	12,930円	クリーンルーム1
	B6	集束イオン走査電子顕微鏡	エスアイアイ・ナノテクノロジー(株)	13,040円	20,860円	26,080円	加工・評価室1
	B7	熱酸化炉	光洋サーモシステム(株)	950円	1,510円	1,890円	クリーンルーム2
	B8	深堀りドライエッチング装置	サムコ(株)	5,310円	8,500円	10,620円	クリーンルーム1
	B9	磁気中性線放電ドライエッチング装置	(株)アルバック	5,330円	8,520円	10,650円	クリーンルーム1
	B10	ドライエッチング装置	サムコ(株)	920円	1,460円	1,830円	クリーンルーム2
	B11	電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置	(株)エリオニクス	3,650円	5,840円	7,300円	クリーンルーム2
	B12	シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム	住友精密工業(株)	4,270円	6,820円	8,530円	クリーンルーム1
	B13	シリコン犠牲層ドライエッチングシステム	XACTIX	2,150円	3,440円	4,300円	クリーンルーム2
	B14	赤外フェムト秒レーザ加工装置	AVESTA PROJECT	3,580円	5,720円	7,150円	加工・評価室2
	B15	レーザーアニール装置	AOV(株)	3,390円	5,420円	6,780円	加工・評価室2
	B16	紫外線ナノインプリントボンダアライメント装置	ズース・マイクロテック(株)	4,560円	7,290円	9,110円	イロールーム
	B17	基板接合装置	ズース・マイクロテック(株)	4,140円	6,620円	8,280円	イロールーム
	B18	レーザダイシング装置	(株)東京精密	6,830円	10,930円	13,660円	加工・評価室1
	B19	ダイシングソー	(株)DISCO	620円	990円	1,240円	加工・評価室1
	B20	真空マウンター	日本電気(株)	530円	850円	1,060円	加工・評価室1
	B21	紫外線照射装置	(株)テクビジョン	240円	380円	470円	加工・評価室1
	B22	エキスパンド装置	(株)テクビジョン	130円	200円	250円	加工・評価室1
	B23	ウェッジワイヤボンダ	ハイソル(株)(ウエスト・ボンド社)	270円	420円	530円	加工・評価室2
	B24	ボールワイヤボンダ	ハイソル(株)(ウエスト・ボンド社)	280円	440円	550円	加工・評価室2
	B25	ダイボンダ	ハイソル(株)(ウエスト・ボンド社)	250円	390円	490円	加工・評価室2
	B26	ナノインプリントシステム	Obducat Technologies AB社	1,090円	1,740円	2,170円	イロールーム
B27	赤外透過評価検査/非接触厚み測定機	(株)モリテックス	1,030円	1,640円	2,050円	イロールーム	
B28	電子線蒸着装置 (2)	大阪真空機器製作所	410円	660円	820円	加工・評価室2	
B29	高性能マッフル炉	アズワン	50円	70円	90円	加工・評価室2	
B30	UVオゾンクリーナー・キュア装置	サムコ(株)	570円	900円	1,130円	クリーンルーム2	
B51	パルレン成膜装置	SCS	360円	580円	720円	桂クリーンルーム	
B52	ICP-RIE装置	(株)アルバック	510円	810円	1,010円	桂クリーンルーム	
B53	簡易RIE装置	サムコ(株)	330円	520円	650円	桂クリーンルーム	
B54	ウエハ接合装置	ボンデック(株)	4,600円	7,350円	9,190円	桂クリーンルーム	
B55	ナノインプリント装置	(株)マルニ	180円	290円	360円	桂クリーンルーム	
B56	ダイシング装置	(株)DISCO	580円	930円	1,160円	桂クリーンルーム	

別表1(2). 装置等の利用負担金表

令和元年10月1日 改定

装置群	No.	装置等		利用料金(一時間当り)			設置場所
		機器名	メーカー名	タイプA	タイプB	タイプC	
C ナノ材料分析・評価装置	C1	超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡	(株)日立ハイテクノロジーズ	4,860円	7,780円	9,720円	加工・評価室1
	C2	分析走査電子顕微鏡	(株)日立ハイテクノロジーズ	6,770円	10,830円	13,540円	加工・評価室1
	C3	高速液中原子間力顕微鏡	(株)生体分子計測研究所	2,590円	4,140円	5,170円	加工・評価室2
	C4	走査型プローブ顕微鏡システム	JPKインスツルメンツ	2,350円	3,760円	4,700円	加工・評価室2
	C5	共焦点レーザー走査型顕微鏡	オリンパス(株)	2,520円	4,030円	5,040円	加工・評価室2
	C6	3D測定レーザー顕微鏡	オリンパス(株)	1,010円	1,620円	2,020円	加工・評価室1
	C8	全反射励起蛍光イメージングシステム	オリンパス(株)	2,060円	3,300円	4,120円	加工・評価室2
	C9	長時間撮影蛍光イメージングシステム	オリンパス(株)	1,570円	2,500円	3,130円	加工・評価室2
	C10	X線回折装置	(株)リガク	2,740円	4,380円	5,480円	加工・評価室1
	C11	分光エリブソメーター	大塚電子(株)	1,670円	2,670円	3,340円	クリーンルーム2
	C12	光ピンセットシステム	JPKインスツルメンツ	1,980円	3,160円	3,950円	加工・評価室2
	C13	ゼータ電位・粒径測定システム	大塚電子(株)	1,080円	1,730円	2,160円	加工・評価室2
	C14	ダイナミック光散乱光度計	大塚電子(株)	1,440円	2,300円	2,880円	加工・評価室2
	C15	触針式段差計1	BRUKER	470円	740円	930円	クリーンルーム2
	C15	触針式段差計2	BRUKER	470円	740円	930円	加工・評価室1
	C16	マイクロシステムアナライザ	ポリテックジャパン(株)	2,850円	4,560円	5,700円	加工・評価室1
	C17	(プローバ)	(株)日本マイクロニクス	640円	1,020円	1,270円	加工・評価室1
	C18	(真空プローバ)	カスケード・マイクロテック(株)	2,490円	3,980円	4,970円	加工・評価室1
	C19	パワーデバイスアナライザ+(C17プローバ)	アジレント・テクノロジー(株)	810円	1,290円	1,610円	加工・評価室1
	C20	インピーダンスアナライザ+(C18真空プローバ)	アジレント・テクノロジー(株)	340円	540円	670円	加工・評価室1
	C21	光ヘテロダイン微小振動測定装置	ネオアーク(株)	1,070円	1,700円	2,130円	加工・評価室2
	C22	超微小材料機械変形評価装置	(株)エリオニクス	1,070円	1,700円	2,130円	加工・評価室2
	C24	セルテストシステム	(株)東陽テクニカ(Solartron Analytical 社製)	1,060円	1,690円	2,110円	加工・評価室2
	C25	卓上顕微鏡(SEM)	(株)日立ハイテクノロジーズ	400円	630円	790円	クリーンルーム1
	C26	高周波伝送特性測定装置(C27+C28+C29)	(株)アポロウェーブ	360円	570円	710円	加工・評価室1
	C27	(RFプローブキット)	(株)アポロウェーブ	150円	230円	290円	加工・評価室1
	C28	(ネットワークアナライザ)	(株)アポロウェーブ(ROHDE&SCHWARZ社製)	360円	580円	720円	加工・評価室1
	C29	(半導体パラメータアナライザ)	(株)アポロウェーブ(Keithley Instruments社製)	360円	570円	710円	加工・評価室1
	C30	強誘電体特性評価システム	(株)東陽テクニカ	730円	1,160円	1,450円	加工・評価室1
	C31	接触式シート抵抗測定器	ナブソン(株)	310円	500円	620円	加工・評価室1

備考

- 上記表中の利用料は以下の利用タイプに区分された1時間当たりの機器利用に係る金額(消費税相当額を含む)であり、これに当該機器の利用時間数を乗じた金額が利用料金となります。
 - ・タイプA: 学術研究機関の利用、学術研究機関との共同研究による企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用、中小企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用(標準利用負担金(タイプC)の額の50%を10円単位で四捨五入した額とする)
 - ・タイプB: 中小企業を除く企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用及びナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない学術研究機関との共同研究による企業の利用(標準利用負担金(タイプC)の額の80%を10円単位で四捨五入した額とする)
 - ・タイプC: ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない企業の単独利用
- 1時間未満の機器利用及び1時間を超える機器利用に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の機器利用として、利用料金を算出するものとします。
- 複数の機器を利用する場合については、各機器の利用料を合算した金額が利用料金となります。
- 上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、表4の基本料金を負担いただきます。
- 中小企業とは中小企業基本法第2条における中小企業者の範囲に含まれる者を言います。

業種分類	中小企業基本法の定義
製造業その他	資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業	資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業	資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業	資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

別表第2 利用負担金の上限額

利用者種別	利用料（1テーマ当たり）
第9条に掲げる1号利用者、4号利用者及び5号利用者	330万円
上記以外の者	1,430万円

備考

- 1 上記表中の利用料は、1テーマ当たりの利用に係る上限額（消費税相当額を含む。）である。

別表第3 装置等利用に係る実験室等の基本料金

利用料（1時間当たり）
1,000円

備考

- 1 上記表中の利用料は、1時間当たりの実験室等利用に係る金額（消費税相当額を含む。）であり、これに実験室等の利用時間に乗じた金額を1人当たりの基本料金とする。
- 2 複数の者が実験室等を利用する場合については、上記1の1人当たりの基本料金に実験室等の利用人数に乗じた金額を基本料金とする。

別表第4 技術代行等における技術料

区分	1時間当たり	1日当たり
技術補助	3,400円	27,200円
技術代行	3,400円	27,200円
事前講習	3,400円	27,200円

備考

- 1 上記表中の料金は、1日又は1時間の技術代行等に係る金額（消費税相当額を含む。）であり、これに利用日数又は利用時間数に乗じた金額を技術料とする。
- 2 1時間未満の技術代行等及び1時間を超える技術代行等に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の技術代行等として、技術料を算出するものとする。

別表第5 サテライトラボ（専有部分）・セミナー室の利用料金

実験室等	利用料	
	1日当たり	1時間当たり
サテライトラボ（専有部分）	168円	21円
セミナー室		

備考

- 1 上記表中の料金は、実験室等の床面積1平方メートルあたりの1日又は1時間の利用にかかる金額（消費税相当額を含む。）であり、これに当該実験室等の床面積及び利用日数又は利用時間数に乗じた金額とする。
- 2 1時間未満の実験室等利用及び1時間を超える実験室等利用に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の実験室等利用として、利用料金を算出するものとする。
- 3 複数の実験室等を利用する場合については、各実験室等の利用料を合算した金額を利用料金とする。

別表第6 装置等の利用中止に伴うキャンセル料

区 分	キャンセル料
装置利用日の6営業日前から2営業日前まで	利用負担金の額の25%
装置利用日の4営業日前から5営業日前まで	利用負担金の額の50%
装置利用日当日から3営業日前まで	利用負担金の額の100%

備 考

- 1 利用負担金の額とは、利用を許可された装置等の利用負担金の額であり、第3条第1項及び第9条に基づき算出した額とする。
- 2 営業日とは、利用内規第3条に規定する利用日とする。
- 3 キャンセル料に円未満の端数が出た場合は、その端数を切り上げるものとする。

新規利用者等の利用負担金内規

(令和元年7月30日拠点マネージャー裁定制定)

(趣旨)

第1条 この内規は、京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点（以下「ハブ拠点」という。）の新規利用者等に対する装置等（京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点利用負担金内規（以下「利用負担金内規」という。）の別表第1に定める微細加工装置群（別表第1のAからC）の装置等に限る。以下同じ。）の利用負担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(新規利用者の要件)

第2条 新規利用者とは、当該利用に係る申請時点の利用責任者（京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点利用内規（以下「利用内規」という。）第7条第7項に定めるものをいう。以下同じ。）であって、初めて利用内規第6条の利用形態によりハブ拠点を利用するものをいう。

(新規利用者の利用負担金の額)

第3条 新規利用者の装置等の利用負担金の額（以下「新規利用負担金」という）は、当該新規利用者の利用内規第5条各号に掲げる区分に応じ利用負担金内規第3条及び第9条により算出した利用負担金の額（以下「標準利用負担金」という。）の3分の2に相当する額（その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）とする。

2 新規利用負担金は、新規利用者が利用内規第7条第1項に基づき初めて申請を行った利用期間（以下「新規利用期間」という。）に限り適用し、当該新規利用者が、再度利用内規第7条第1項に定める利用に関する申請を行った場合には適用しない。

3 新規利用負担金は、新規利用者が初めて許可を受けた日から6か月以内（以下「新規利用期間」という。）に限り適用する。

4 新規利用負担金の累積額が、利用負担金内規別表第2左欄に定める利用者の種別に応じて同表右欄に定める額（以下「負担上限額」という。）を超えた場合、当該新規利用者に対し、当該超えた額の負担は求めないものとする。

5 新規利用者は、利用を許可されたテーマごとに負担上限額をあらかじめ納付しておくことにより、当該利用を許可された期間中は、新規利用負担金を都度納付することなく、当該テーマにおいて装置等を利用することができる。この場合において、当該テーマの使用実績に応じた新規利用負担金の累積額が負担上限額を下回っても、一旦納付された負担上限額との差額は返還しない。

(紹介者)

第4条 紹介者とは、新規利用者に対してハブ拠点利用を誘引した既存の利用責任者であって、当該新規利用者の別表第1左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表右欄に掲げる要件を満たすものをいう。

(紹介者の利用負担金の額)

第5条 紹介者の装置等の利用負担金の月額、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

- (1) 当該紹介者が紹介した新規利用者の新規利用期間であって、かつ、当該紹介者が紹介した新規利用者の新規利用負担金の累積額が当該新規利用者の負担上限額に達するまでの期間（ただし、当該紹介者が新規利用者でもある場合にあつては、自身の新規利用者としての新規利用期間を除く

く。) 当該紹介者の利用内規第5条各号に掲げる区分に応じ利用負担金内規第3条及び第9条により算出したその月の利用負担金の総額から、当該紹介者が紹介した新規利用者の前月の標準利用負担金の総額の2分の1に相当する額を減額した額

(2) 当該紹介者が新規利用者でもある場合の、自身の新規利用者としての新規利用期間 第3条により算出したその月の新規利用者としての装置等の利用負担金の総額

(3) 前2号以外の期間 当該紹介者の利用内規第5条各号に掲げる区分に応じ利用負担金内規第3条及び第9条により算出したその月の装置等の利用負担金の総額

2 紹介者の装置等の利用負担金の累積額が、当該紹介者の負担上限額を超えた場合、当該紹介者に対し、当該超えた額の負担は求めないものとする。

3 紹介者は、利用を許可されたテーマごとに負担上限額をあらかじめ納付しておくことにより、当該利用を許可された期間中は、装置等の利用負担金を都度納付することなく、当該テーマにおいて装置等を利用することができる。この場合において、当該テーマの使用実績に応じた利用負担金の累積額が負担上限額を下回っても、一旦納付された負担上限額との差額は返還しない。

附 則

この内規は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1 紹介者の要件（新規利用者と紹介者の関係）

新規利用者の区分	要件
利用内規第5条第1項第1号（大学の教職員及び学生）及び第2号（学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者）に掲げる者	原則として、同一研究室等に属さない者
利用内規第5条第1項第4号（その他、運営責任者が特に必要と認めた者）に掲げる者	上記に準じる
利用内規第5条第1項第3号（企業等に所属し、研究開発に従事する者）に掲げる者	原則として、同一企業等に属さない者（ただし、同一企業等の場合であっても、事業場が異なる場合は異なる企業等とみなす。）